

装置担当者表 Equipment responsible persons list				Last update 2024/4/9		
メインクリーンルーム Main clean room (1F clean room)						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
熱酸化炉(Thermal oxidation furnace)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
水素アニール炉 (H2 anneal furnace)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
CCP-RIE#3	大庭 (Oba, T.Tanaka Lab)	6909	邱 (Qiu, T.Tanaka Lab.)	6909	T.Tanaka Lab	6909
ICP-RIE#1	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
ICP-RIE#2	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256	【研究室内担当】 田中(秀): Zhu (B4) 小野: Han (R), Yamanami (M1) 金森: Huang(As)	6937 5810 4894	猪股 (Inomata, Kanamori Lab)	4894
CCP-RIE#1	篠田 (Shinoda, T.Tanaka Lab) 劉 (Liu,	6909	Vergara(S.Tanaka)	6937	T.Tanaka Lab	6909
CCP-RIE#2 (Cl2 RIE)	Toan(Ono Lab)	5810			戸田(Toda, Ono Lab)	5810
FAB	池田(Ikeda, Kanamori Lab)	4894			Kanamori Lab	4894
イオン注入装置 (Ion implantation)	Vergara(S.Tanaka)	6937				
プラズマTEOS CVD (Plasma-enhanced TEOS CVD)	渡辺(Watanabe, MNC)	6256	Vergara(S.Tanaka)	6937	塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
EVG wafer bonder					Vergara(S.Tanaka)	6937
プラズマ/オゾンTEOS CVD (Plasma/ozone TEOS CVD)	加藤 (Kato, T.Tanaka Lab)	6909	辻 (Tsuji, T.Tanaka) 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
プラズマSiN CVD (Plasma-enhanced SiN CVD)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909				
LP-CVD	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
二周波励起RIE (Dual frequency RIE)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
エリプソメーター (Ellipsometer)	大庭 (Oba, T.Tanaka Lab)	6909	加藤 (Kato, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
接触式段差計(Stylus profilometer)	富永 (Tominaga, T.Tanaka Lab)	6909	劉 (Liu, T.Tanaka)		T.Tanaka Lab	6909
UV照射器 (UV exposure)	加藤 (Kato, T.Tanaka Lab)	6909	岩沼 (Iwanuma, T.Tanaka)	6909	T.Tanaka Lab	6909
UHV-CVD	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
RTA#1	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
SiNエッチャー (SiN etcher)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
O2アッシャー (O2 asher)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
有磁場ICP-RIE (Magnetic ICP-RIE)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
SiCN Cat-CVD	戸田 (Toda, Ono Lab)	5810			Ono Lab	5810
イオンビームミリング装置 (Ion beam milling)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937	Fang (S.Tanaka Lab)	6937	Vergara(S.Tanaka Lab)	6937
ICP-RIE#3 (Pegasus Advanced)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256	【研究室内担当】 田中(秀): Wang X. (D) 小野: Zhao (D2), Lei (D1) 金森: 千葉(D1)	9375810489	猪股 (Inomata, Kanamori Lab)	4894
超臨界CO2乾燥装置 (Supercritical CO2 drier)	Ou (Ono Lab)	5810			戸田 (Toda Ono Lab)	5810
金属蒸着室 Metal Deposition room (1F clean room)						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
RF magnetron sputter (ANELVA)	増淵(Masubuchi, Tohmyoh Lab)	6898			木村(由)(Kimuta, Tohmyoh Lab)	6898
DC対向ターゲットスパッタ (Facing target DC sputter)	戸田 (Toda, Ono Lab)	5810				
RF対向ターゲットスパッタ (Facing target RF sputter)	田中(秀) (Tanaka, S.Tanaka Lab)	6937				
EB蒸着 (EB evaporation)	F. Setiawan(S.Tanaka Lab)	6937				

RF magnetron sputter (ULVAC)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
RF magnetron sputter #1 (Shibaura)	Liu (Yugami Lab)	6925	【研究室内担当】 田中(秀): Guo (D) 小野: Kao (D) 金森: Minh (PD)		渡辺(Watanebe, MNC) 猪股(Inomata, Kanamori Lab)	6256 4894
RF magnetron sputter #2 (Shibaura)	Kao (Ono Lab), Rahul (Ono Lab)	5810	【研究室内担当】 田中(秀): Guo (D) 金森: Minh(PD)		渡辺(Watanebe, MNC) 猪股(Inomata, Kanamori Lab)	6256 4894
ECR plasma sputter					S. Tanaka Lab	6937
4探針測定器(Four-probe resistivity measurement)	岩沼 (Iwanuma, T.Tanaka)	6909	篠田 (Shinoda, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
Wafer bonder (先端融合Technofine)					S. Tanaka Lab	6937
ECR ion beam sputter					Ono Lab	5810
High-temp RF magnetron sputter	猪股 (Inomata, Kanamori Lab)	4894				
イエロールーム Yellow room (1F clean room)						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
レーザー描画装置#1 (Laser lithography system #1)	辻 (Tsuji, T.Tanaka) 申 (Shen, T.Tanaka)	6909	岩沼 (Iwanuma, T.Tanaka) 富永 (Tominaga, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
EVG mask aligner					鈴木(Y. Suzuki, S.Tanaka Lab)	6937
EVG接合用基板洗浄 (EVG megasonic cleaner)	小川(Ogawa, S.Tanaka Lab)	6937			S. Tanaka Lab	6937
EVGプラズマ表面活性化装置 (EVG plasma activator)	小川(Ogawa, S.Tanaka Lab)	6937			S. Tanaka Lab	6937
二流体洗浄装置 (Two-fluid cleaner)	山下(Yamashita, S.Tanaka Lab)	6937			門田(Kadota, S.Tanaka Lab)	6937
HMDS処理装置 (HMDS treatment system)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
マスクアライナーSUSS#1 (Mask aligner SUSS#1)	堂守(Doumori, MNC)	6256				
高温乾燥機 (High-temperature oven)	篠田 (Shinoda, T.Tanaka Lab)	6909	辻 (Tsuji, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
マスクアライナーSUSS#2 (Mask aligner SUSS#2)	堂守(Doumori, MNC)	6256				
スピナー(Spin coater)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
暗室 Dark room (1F clean room)						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
EB描画装置(Electron beam lithography、JEOL-EB)	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909	大庭 (Oba, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
FE-SEM	小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
レーザー加工室 Laser fab. Room 2F						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
YAGレーザー (YAG laser)	西野 (Nishino, Ono Lab)	5810	菊地 (Kikuchi, Ono Lab)	5810		
薄膜評価装置 (Thin film characterization system)					渡辺 (Watanabe, MNC) 堂守 (Doumori, MNC)	6256
パリレン蒸着器 (Palylene evaporator)	上路(Joji, S.Tanaka Lab)	6937	吉武(Yoshitake, S. Tanaka Lab) 小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6937 6909	S.Tanaka Lab	6937
ホール効果測定装置 (Hall effect measure)					Kanamori Lab	4894
PL測定装置 (PL measurement)	塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937				
PLD	Tang(S.Tanaka Lab)	6937			Vergara(S.Tanaka Lab)	6937
VIM/冷却CCDカメラ(VIM/cooled CCD camera)					戸田(Ono lab)	5810
分析室 Analysis room 2F						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
高分解能SEM(High resolution SEM,日立)	渡辺(MNC)[Watanabe(MNC)]	6256				
FIB	菅野(Kanno, Tohmyo Lab)	6898			木村(由)(Kimura, Tohmyoh Lab)	6898

Multi-target sputter(Anelva)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937	Vergara(S.Tanaka Lab)	6937	S. Tanaka Lab.	6937
急冷機構付真空加熱装置 (Lapid cooling vacuum heater)					Haga Lab	5251
日立イオンスパッタコータ	渡辺(Watanabe, MNC)	6256				
光学測定室 Optical meas. Room 2F						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
紫外分光エリプソメーター (Ultraviolet spectroscopic ellipsometer)	Sahani (Kanamori Lab)	4894			Kanamori lab	4894
XeF2ガス等方性Siエッチャー (XeF2 gas Isotropic Si etcher)					S. Tanaka lab	6937
プラズマダイヤモンドCVD (Plasma diamond CVD, Astex)	Toan (Ono Lab)	5810			Ono Lab	5810
赤外線ウェハ接合評価装置 (Wafer bonding inspector)	竹内 (Takeuchi, Higurashi Lab)		根本(Nemoto, S.Tanaka Lab)	6937		
断面試料作製研磨装置 (Polishing SEM sample maker)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256				
断面試料作製ミリング装置 (Ion milling SEM sample maker)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256				
圧縮引張試験機 (Tension and compression fatigue tester)					S. Tanaka Lab.	6937
三菱赤外線カメラ(Mitsubishi infrared camera)					塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
アビオニクス赤外線カメラ(Avionics infrared camera)	根本 (Nemoto, S.Tanaka Lab)	6937			塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
組立評価室 Assembly test room 2F						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
電解めっき装置#1 (Electroplating#1)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
電解めっき装置#2 (Electroplating#2)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
レーザードップラー振動計 (Laser doppler vibrometer、ネオアーク)	富澤 (Tamazawa, Ono Lab)	5810	Wang (S. Tanaka Lab)	6937	Ono Lab	5810
紫外線露光装置 (UV exposure)	渡辺(Watanabe, MNC)	6256				
屈折率測定装置 (Refractive index meter)					Kanamori Lab	4894
ワイヤボンダ#1 (Wire bonder#1)	Vergara(S.Tanaka Lab)	6937				
14(8.5)GHzネットワークアナライザー (14GHz network analyzer)	門田(Kadota, S.Tanaka Lab)	6937				
インピーダンスアナライザー (Impedance analyzer)	鶴岡 (Tsuruoka, Haga Lab)					
フリップチップボンダ#2 (Flip chip bonder#2)	Zhao(Ono Lab)	5810	Tang (S.Tanaka Lab)	6937		
ダイサー (Dicer)	Minh (Kanamori Lab)	4894	堂守(Doumori, MNC)	6256	Kanamori Lab	4894
卓上コイル巻き器	Ou (Ono Lab)	5810			戸田(Toda, Ono lab)	5810
電気実験室 Erectric experiment room 3F						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
基板加工装置 (Circuit board plotter)					塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
旋盤 (Lathe)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
ボール盤 (Drill press)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
フライス盤 (Milling machine)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
3階実験室 3F experiment room						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
マイクロシステムアナライザMSA-500,400 (Microsystem analyzer MSA-500,400)	Zhao (Ono Lab)	5810	【研究室内担当】 PSV: Fang (S. Tanaka Lab), TMS:Tang (S. Tanaka Lab) PMA: -		戸田(Toda, Ono Lab)	5810
全真空顕微FTIR (FT-IR)	大橋 (Ohashi, Ono Lab)	5810	太田(Ota, S.Tanaka Lab)	6937		
フリップチップボンダ#1 (Flip chip bonder#1)					清水 (Shimizu, Yugami Lab)	6925
研削装置 (Grinding machine)	塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937				
高周波レーザードップラー振動計 (High-frequency laser doppler vibrometer)	Vergara (S.Tanaka Lab)	6937				
紫外可視近赤外分光光度計 (UV/Vis./IR spectrometer)	神永 (Kaminaga, Matsumoto Lab)	7267				
レーザダイサー (Laser dicer)	Vergara (S.Tanaka lab)	6937				

接合力評価装置 (Bonding force measurement system)	鈴木(裕)(Y. Suzuki, S.Tanaka Lab)	6937				
インピーダンス/マテリアルアナライザ (Impedance/material analyzer)						
ワイヤボンダ#2 (Wire bonder#2)					塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
ナノマシニング棟 Nano machining building (clean room)						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
ESCA分析装置 (XPS)	岡田(Okada, Okada Lab)	7122	尾崎(Ozaki, Samukawa)	5318		
走査型プローブ顕微鏡(Olympus) (Olympus SPM)	小野(Ono, Ono Lab)	5810				
走査型プローブ顕微鏡(Shimadzu) (Shimadzu SPM)	小野(Ono, Ono Lab)	5810				
投影露光装置 (Ushio projection aligner) →要修理, 復旧予定なし(by猪股)					猪股(Inomata, Kanamori Lab)	4894
プラズマCNT-CVD (Plasma CNT-CVD)					Ono Lab	5810
微小振動計測装置 (Micro vibration measurement, 2 beams)	富澤 (Tamazawa, Ono Lab)	5810			小野(Ono, Ono Lab)	5810
レーザー描画装置#2 (Laser lithography system #2)	渡辺(Watanabe, MNC)	6256				
UHV-STM&AFM	小野 (Ono, Ono Lab)	5806				
簡易マスク作製装置 (Simple photo-mask maker)					Ono Lab	5810
パターンジェネレーター (Pattern generator)	戸津(Totsu, μ SIC)	229-4113				
真空フリップチップボンダー					塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
量子 Quantum Building						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
全自動多目的X線回折装置 (XRD)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937	阿部 (Abe, Watanabe Lab)		Vergara(S.Tanaka lab)	6937
その他 Others						
装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd responsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
配管溶接機 (Process pipe welder)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256				
M: Master student, D: Doctor student						
As: Asistant professor, Lec: Lecturer, AP: Associate professor, P: Professor						